

十、申請專利範圍：

1. 一種座標檢測裝置，包含有：

保持部，係可保持被檢體者；

搖動機構，係使前述保持部朝預定角度旋轉者；

- 5 一對導軌，係挾持前述被檢體而對向配置於前述保持部上者；

引導構件，係可在前述一對導軌上移動，且與前述被檢體之表面對向而成非接觸者；

- 10 聚光源，係設置成可朝與前述引導構件之移動方向垂直之方向移動，且聚光斜向照射於前述被檢體之表面者；

- 15 操作部，係在藉由前述搖動機構將前述保持部傾斜成前述預定角度的狀態下，使前述引導構件與前述聚光源分別移動，而可藉由前述聚光之照射位置來指定前述被檢體上之缺陷位置者；及

座標檢測部，係可由前述引導構件與前述聚光源之各移動位置的位置資訊，求得由前述聚光所指定之前述缺陷位置之座標資料者。

- 20 2. 如申請專利範圍第1項之座標檢測裝置，係於藉前述被檢體而反射的聚光之反射光程上設置遮光構件。
3. 如申請專利範圍第2項之座標檢測裝置，其中前述遮光構件係配置成於前述引導構件與前述遮光構件上形成使檢查者可目視前述被檢體上的缺陷之間隙。
4. 如申請專利範圍第1項之座標檢測裝置，係設有對前述

被檢體照射巨觀照明光之巨觀照明部，且前述引導構件係安裝成在前述保持部立起預定角度的狀態下，使前述引導構件之長邊方向沿著與巨觀照明光的照射方向相同之方向延伸。

5. 如申請專利範圍第1項之座標檢測裝置，其中前述聚光係雷射光。
6. 如申請專利範圍第1項之座標檢測裝置，其中前述引導構件具有使檢查者可目視照射於前述被檢體的前述聚光之間隙。
7. 如申請專利範圍第1項之座標檢測裝置，其中前述聚光源係配置成前述聚光朝向與前述引導構件之長邊方向交錯之斜下方。
8. 如申請專利範圍第1項之座標檢測裝置，其中前述聚光源係將前述聚光之投射角度設定為相對前述被檢體之表面為 $30\sim 70^\circ$ ，以使前述聚光之照射位置不會成為前述引導構件之光影。
9. 一種被檢體檢查裝置，係可對被檢體照射巨觀照明光，並以目視觀察前述被檢體上的缺陷者，其特徵在於包含有：

巨觀照明部，係將前述巨觀照明光照射於前述被檢體者；

保持部，係可保持前述被檢體者；

搖動機構，係使前述保持部旋轉預定角度者；

一對導軌，係挾持前述被檢體而對向配置於前述保

持部上者；

引導構件，係可於前述被檢體表面上移動，而與前述被檢體之表面對向且成非接觸者；

5 聚光源，係設置成可朝與前述引導構件之移動方向垂直之方向移動，且將聚光斜向照射於前述被檢體之表面者；

10 操作部，係在藉由前述搖動機構將前述保持部傾斜前述預定角度的狀態下，使前述引導構件與聚光源各自移動，並藉前述聚光之照射位置指定前述被檢體上的缺陷位置者；及

座標檢測部，係可由前述引導構件及前述聚光源的各移動位置之位置資訊，求得前述聚光所指定的前述缺陷位置之座標資料者。

15 10. 一種被檢體檢查裝置，係可對被檢體的特定部位進行顯微觀察者，其特徵在於包含有：

巨觀照明部，係用以對前述被檢體照射巨觀照明光者；

保持部，係可保持前述被檢體者；

搖動機構，係使前述保持部朝預定角度旋轉者；

20 一對導軌，係挾持前述被檢體而對向配置於前述保持部上者；

引導構件，係可於前述一對導軌上移動，且與前述被檢體之表面對向而成非接觸者；

聚光源，係設置成可朝與前述引導構件之移動方向

垂直之方向移動，且聚光斜向照射於前述被檢體之表面者；

5 操作部，係在藉由前述搖動機構將前述保持部傾斜前述預定角度的狀態下，使前述引導構件與前述聚光源分別移動，而可藉由前述聚光之照射位置來指定前述被檢體上之缺陷位置者；

座標檢測部，係可由前述引導構件與前述聚光源之各移動位置的位置資訊，求得由前述聚光所指定之前述缺陷位置之座標資料者；及

10 顯微觀察部，係設置成可對前述被檢體作相對移動，並且根據前述座標檢測部所求得之前述座標資料而移動到前述缺陷位置，以進行顯微鏡觀察。

11. 如申請專利範圍第10項之被檢體檢查裝置，其中前述保持部具有可使前述引導構件退避以防止與前述顯微觀察部互相干涉之退避範圍。

15